

就活生必見!!

半導体の進化無くして

AIの進化無し

◆ 基調講演 ◆

出口 淳 (キオクシア)

「半導体の進化無くして AI の進化無し」

小森 隆行 (SUMCO)

「シリコンウェーハから見る AI 社会と半導体」

◆ 技術者講演 ◆

就活、入社、そして仕事のやりがい～技術者のリアル、会社概要は話しません!

「大学で数学を専攻した私が、宇宙開発産業を経由して、半導体メモリ産業に転身・活躍するまで!？」

柄木田 万平
(キオクシア)

「最先端の半導体プロセス開発に携わる海外駐在員の経験」

池 進一
(東京エレクトロン)

「AI チップ向け露光装置の展開と露光装置への AI の活用」

吉田 晶弘
(キヤノン)

「大学から企業へ 色々な立場で半導体に関わって」

森山 匠
(堀場エステック)

「ピーカー実験から半導体洗浄装置ができるまで」

奥谷 学
(SCREENセミコンダクタソリューションズ)

「SEM ユーザから開発者へ -計測装置で技術の進化を支えたい-」

酒井 ひとみ
(日立ハイテク)

「AI 処理機能を搭載したイメージセンサーを実現する半導体プロセス開発の魅力」

上林 拓海
(ソニーセミコンダクタソリューションズ)

日時

2021年9月11日(土) 9:50～12:10

会場

応物講演会内@名城大学/オンライン S101会場
非会員は[こちら](#)。または右のQRコードからお入りください。

参加費

無料 ※事前登録不要・応物非会員歓迎!



主催

応用物理学会・SEAJ 日本半導体製造装置協会

企画

界面ナノ電子化学研究会・インダストリアルチャプター

問い合わせ先

公益社団法人 応用物理学会事務局

Tel : 03-3828-7721 Fax : 03-3828-1810 E-mail : meeting@jsap.or.jp

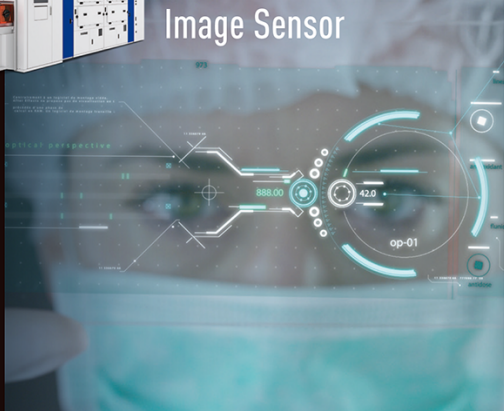
SCREEN



NEW

Spin Scrubber SS-3300S
Coat/Develop Track DT-3000
Direct Imaging System for Advanced Packaging DW-3000

Image Sensor



Memory



Wet Station FC-3100

Single Wafer Cleaner SU-3300
Coat/Develop Track DT-3000

Communication Device

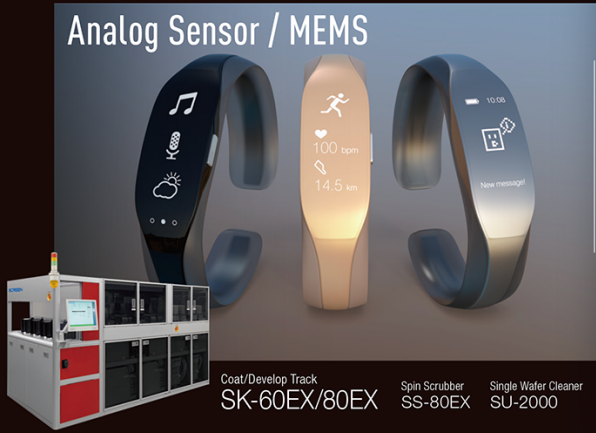


Wafer Pattern Inspection System ZI-2000
Compact Wet Station CW-2000
Laser Annealer LT-3100

Power Device



Analog Sensor / MEMS



Coat/Develop Track SK-60EX/80EX
Spin Scrubber SS-80EX
Single Wafer Cleaner SU-2000



Logic

Ellipsometric Film Thickness Measurement System RE-3500

Flash Lamp Annealer LA-3100

Single Wafer Cleaner SU-3200

